



## KEMOLIT PLATTE PCP

Die Platte wird im Offsetdruck für Mittelgroß- und Großaufträge eingesetzt. Die Platte wird nicht nur als konventionelle Offsetplatte sondern auch als CTP Platte verwendet. Konventionelle Platte wird als einer CTP Platte in der Zusammenstellung mit Belichtungsanlage Lüscher X Pose eingesetzt, die speziell für konventionelle, UV- empfindliche Platten entwickelt wurden. Außerdem können die KEMOLIT® PCP Platten in Basys – Systemen verwendet werden.

Die Platte ist mit einer lichtempfindlichen diazonium - Schicht bedeckt, die in wässrigen alkalischen Entwicklern entwickelt werden.

Mehrfache Anwendung der Druckplatte mit der mikro- pigmentierten Oberfläche ermöglicht die Erzeugung von hervorragenden Kopien. Die KEMOLIT® Platten werden in den Stärken von 0,15mm und 0,30mm für Größe 1300mm hergestellt. Sie können in den Druckmaschinen von verschiedenen Herstellern eingesetzt werden.

### Produkteigenschaften

- Hohe Lichtempfindlichkeit verkürzt die Belichtungszeit
- Die Mikrostruktur von Oberfläche der Druckplatte ermöglicht einen besseren Kontakt zwischen Film und Oberfläche und verringert dadurch die Zeichnungsfehler
- Die Farbe der Platte versichert einen einwandfreien Kontrast der Zeichnung
- Empfindliche Schicht der Druckplatte ermöglicht schnelle Entwicklung ( Hand- oder Maschinenentwicklung)
- Eine richtige Regenerierung der Entwickler beseitigt die Sedimente und erhöht die Leistung der Druckmaschine
- Feste, beständige elektrolytisch oxidierte Oberfläche sichert eine lange Lebensdauer der Druckplatte und Beständigkeit gegen Kratzen und Oxidation
- Elektrochemisch strukturierte Oberfläche ermöglicht eine schnelle Herstellung des Gleichgewichts Farbe-Wasser beim Druck und Erzeugung von Abdruck einer sehr hohen Qualität
- Die erwähnten Eigenschaften verursachen, dass die Platte für Mittelgroß- und Großaufträge einsetzbar ist. Für schwierige Druckbedingungen oder bei Anwendung von UV-Farben ist thermischer Bearbeitung der Druckplatte möglich.

### Technische Daten:

UV- Empfindlichkeit - Wellenlänge im Bereich von 350-450 nm

Auflösevermögen 1-99% bei 200 lpi , 20 µm FM

Entwicklung in den allgemein verwendeten Entwicklern für Offsetplatten

Entwicklungstemperatur 23-24 ° C

Aufträge bis 100 000 Kopien ohne Anlagerung

Nach Anlagerung bis 200 000 Kopien

Brenntemperatur 230-240 ° C bis 5 Minuten

In der Originalverpackung in der Temperatur bis 25 ° C, Feuchte 70% lagern